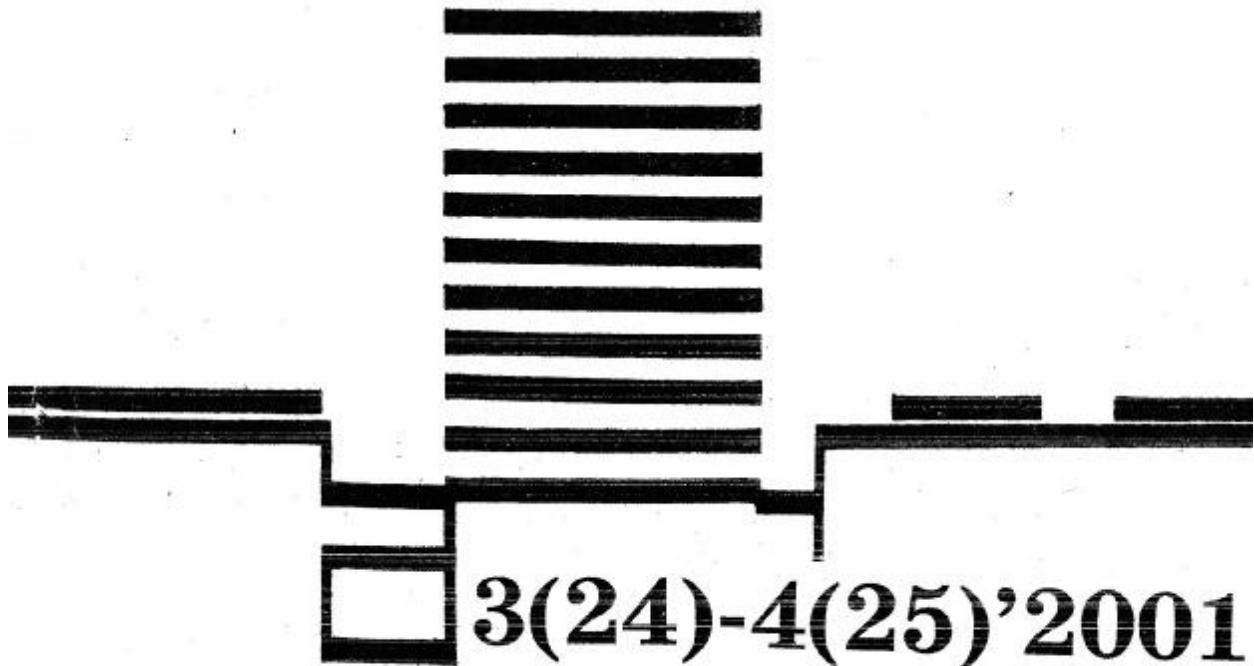


ВІСНИК

Сумського
державного
університету

Серія
Фізика, математика, механіка



□ 3(24)-4(25)'2001

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК СПЛАВУ Ni-Cu В ТЕМПЕРАТУРНОМУ ІНТЕРВАЛІ 300-700 К

В.Б. Лобода*, доц.; С.М. Пирогова*, магіс.; С.І. Проценко, магістр
 (* Сумський державний педагогічний університет)

ВСТУП

Сплави нікелю і міді в масивному стані у всьому інтервалі концентрацій (від 0 до 100%) утворюють твердий розчин (упорядкований при певних концентраціях) із ГЦК -решіткою і параметром від $a_0 = 0,35238$ нм ($C_{Cu} = 0$ ат %) до $a_0 = 0,36150$ нм ($C_{Cu} = 100$ ат %) [1].

Згідно з даними [2] питомий опір ρ_0 і термічний коефіцієнт опору (ТКО) β_0 масивних зразків сплаву дуже суттєво залежать від концентрації компонент:

- при концентрації 40-70 ат % Ni ρ_0 сплаву при $T = 300$ К досягає свого найбільшого значення ($52 \cdot 10^{-8}$ Ом·м), що значно перевищує ρ_0 вихідних компонент – $5,8 \cdot 10^{-8}$ (Ni) та $2,7 \cdot 10^{-8}$ (Cu) Ом·м;
- при концентрації 20-60 ат% Ni β_0 сплаву при $T = 290-400$ К досягає свого найменшого значення $\beta_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ К⁻¹;
- температура Кюрі сплавів менша $\Theta_{0C} = 625$ К для чистого Ni лежить нижче 273 К при концентрації, більшій за 33 ат% Cu.

Якщо фізичні властивості масивних зразків сплаву (Ni-Cu) вивчені детально, що дало конкретний прикладний результат у вигляді сплаву Ni-57 ат% Cu (константан), який знайшов широке застосування в електротехніці, то у випадку тонких плівок дослідження мають фрагментарний характер і пов'язані із вивченням впливу легуючих домішок на електрофізичні властивості конденсатів Cu (М.В. Білоус, В.І. Попов, А.І. Костржицький та ін.).

У той самий час електрофізичні та гальваномагнітні властивості тонких плівок сплавів перебувають постійно в полі зору дослідників (див., наприклад, огляд [3], в якому наведені результати досліджень питомого опору, ефекту Холла, магнітної анізотропії, магнітострікції та доменної структури тонкоплівкових сплавів на основі 3d або РЗМ і За металів). Особливістю плівок (Ni-Cu) сплаву є перспективність її використання в мікроелектроніці як замінників дорогих металів при виготовленні струмопровідних доріжок, низькоомних резисторів і ТКО – 10^{-4} К⁻¹ та ін.

Виходячи із сказаного, в даній роботі було поставлено за метою встановити зв'язок між кристалічною структурою, елементним складом та електрофізичними властивостями (питомий опір і ТКО) тонких плівок сплаву Ni-Cu у всьому інтервалі концентрацій при температурі T=300-700 К.

1 ТЕХНІКА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Для отримання плівкових зразків використовувались вакуум установка ВУП-5М (тиск залишкових газів 10^{-3} - 10^{-4} Па) і методика [4] яка була успішно застосована у попередній роботі [5] при дослідженні електрофізичних властивостей плівок сплаву Ni-Co. Для випарування С і Ni застосовувався резистивний і електронно-променевий метод нагрівання, а для визначення концентрації компонент використовувалися розрахунковий метод, суть якого зрозуміла із схеми, наведеної на рис.1.

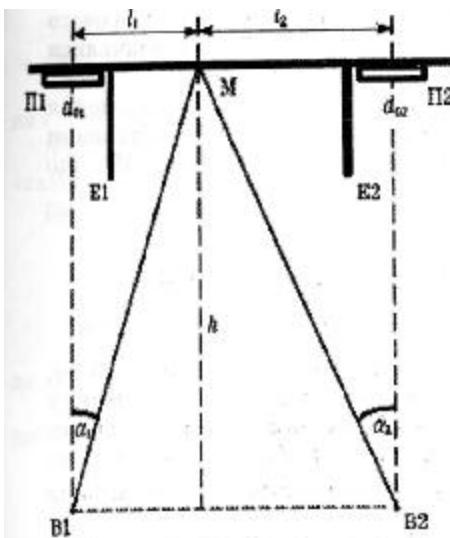


Рисунок 1 - Геометрія системи підкладка-випаровувачі для підрахунку концентрацій компонентів:
Е1, Е2 - екрані;
В1, В2 - випаровувачі;
Π1, Π2 - скляні пластинки для вимірювання товщин d₀₁ і d₀₂

Виходячи із геометрії рис.1, товщину плівки окремих компонент в точці М можна розрахувати за співвідношеннями

$$d_1 = d_{01} \cdot \left[1 + \left(\frac{l_1}{h} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}},$$

$$d_2 = d_{02} \cdot \left[1 + \left(\frac{l_2}{h} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}},$$

де d₀ – товщина плівки в точці, що розміщена над випаровувачем.

Для знаходження концентрації компонент у точці М ми користувалися очевидними співвідношеннями

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{D_1 d_1}{D_1 d_1 + D_2 d_2} \text{ і} \\ C_2 &= \frac{D_2 d_2}{D_1 d_1 + D_2 d_2}, \quad (1) \end{aligned}$$

де D₁ та D₂ – густини плівок кожного з матеріалів.

Враховуючи, що в масивних зразках D_{Ni} ≈ D_{Cu}, співвідношення (1) спрощується до вигляду

$$C_1 = \frac{d_1}{d_1 + d_2} \text{ і } C_2 = \frac{d_2}{d_1 + d_2}, \quad (1')$$

де d = (d₁ + d₂) – товщина сплаву.

Товщини d₀₁ і d₀₂ вимірювалися за допомогою інтерферометра Лінника з відносною похибкою 10% (в інтервалі товщин 50-200 нм) та 20-30% (при d₀<50 нм).

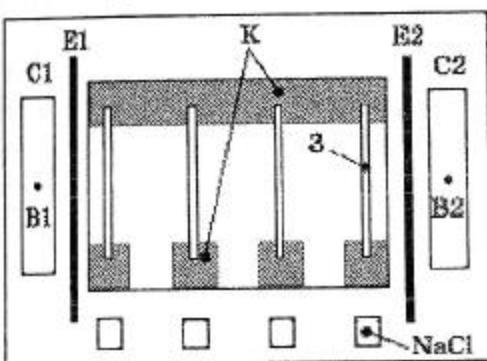


Рисунок 2 - Схема підкладкотримача:
3 – зразок; К – контакти;
NaCl – пластини NaCl;
В1, В2 – проекції випаровувачів на пластини С1 і С2

Конструкція підкладкотримача (рис.2) дозволяє отримувати за один технологічний цикл чотири зразки різної концентрації компонент, але приблизно однакової товщини. Підкладкотримач з'єднаний із термоагрівником, за допомогою якого здійснювалися відпал зразків та стабілізація їх електрофізичних властивостей.

Температура відпалювання контролювалася за допомогою кромель-крапельної термопари.

Терmostабілізація властивостей плівок здійснювалася за схемою “нагрівання-охолодження” зі швидкістю (2-3) К/хв протягом трьох циклів в інтервалі

температур 300-700 К. Опір вимірювався за допомогою цифрового вольтметра В7-23 із точністю $\pm 0,01$ Ом. Питомий опір і ТКО визначалися за даними третього циклу за кривою охолодження зразків.

Електронно-мікроскопічні та електронографічні дослідження проводились за допомогою електронного мікроскопа ЕМ-125. Еталоном для вимірювання міжплощинних відстаней були плівки Al, що забезпечувало точність $\pm 0,001$ нм.

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

2.1. Енергія активації «заліковування» дефектів кристалічної будови

Вимірювання електричного опору плівкових зразків свідчать про те, що перехід до двокомпонентного сплаву не вносить суттєвих змін у розмірно-температурні ефекти. Зокрема, при збільшенні товщини плівки опір монотонно зменшується (пропорційно $1/d$), виходячи на асимптотичне значення ρ_∞ ($\rho_\infty = \lim_{d \rightarrow \infty} \rho$), а в процесі відпалювання зразків спостерігається ефект «заліковування» дефектів кристалічної будови (рис.3), теорію якого запропонував Венд [6].

Згідно з теорією Венда незворотне зменшення опору плівок (рис.3, I стабілізаційний цикл) пов'язано із дифузією атомів залишкової атмосфери із об'єму плівки, а також із «заліковуванням» структурних дефектів (вакансій, міжузлових атомів, дефектів пакування). При конденсації плівок у достатньо сприятливих вакуумних умовах роль першої причини можна звести до мінімуму і зміну опору пов'язувати лише із «заліковуванням» дефектів.

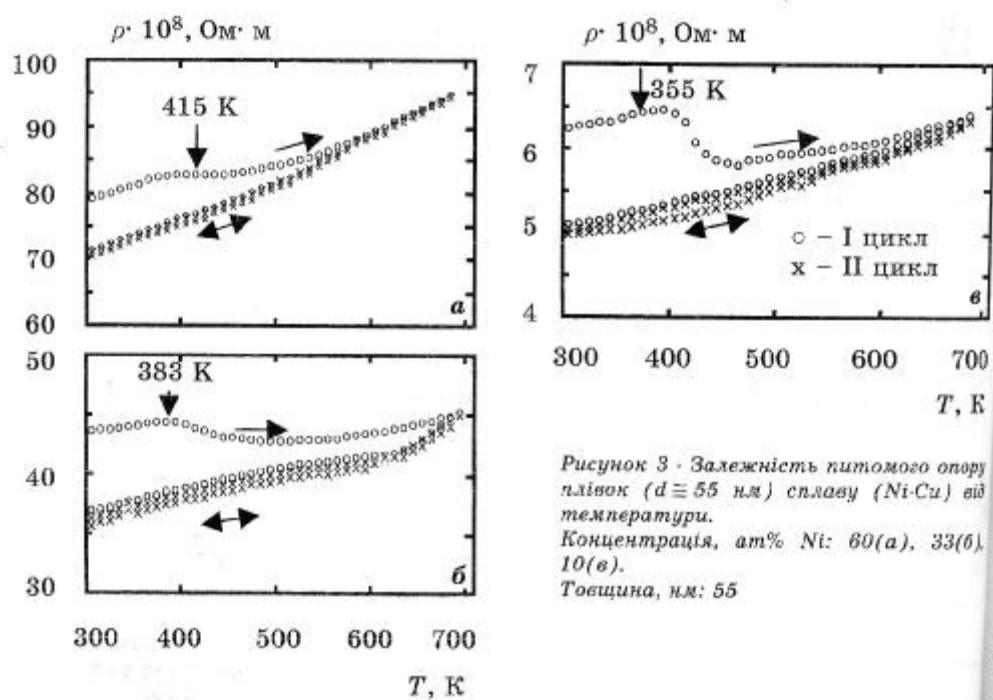


Рисунок 3 - Залежність питомого опору плівок ($d \geq 55$ нм) сплаву (Ni-Cu) від температури.
Концентрація, ат% Ni: 60(а), 33(б), 10(в).
Товщина, нм: 55

Якщо позначити через $r(E)$ внесок в електричний опір структурних змін, обумовлених утворенням одного дефекту, то питомий опір, який т зумовлений дефектами, можна записати у вигляді

$$\rho_i = \int\limits_{(E)} r(E)N(E, t) dE , \quad (2)$$

де t – час відпалювання до температури T , при якій вимірюється ρ_i ;

$N(E, t)$ – кількість дефектів в одиниці об'єму із енергією «заликовування» від E до $E+\Delta E$.

Величина $N(E, t)$ знаходиться із співвідношення

$$\frac{dN(E, t)}{dt} = -c N(E, t) \exp\left(-\frac{E}{kT}\right), \quad (3)$$

де $c = \frac{4\omega_{\max} n}{2\pi}$ (n – число атомів, які утворюють дефект; ω_{\max} – дебаєвська частота);

k – постійна Больцмана.

Із урахуванням (3) рівняння (2) перетворюється до вигляду

$$\rho_i(t) = \int\limits_{E_0(t)}^{\infty} r(E) N_0(E) dE = \int\limits_{E_0(t)}^{\infty} F_0(E) dE , \quad (2')$$

де $F_0(E)$ – функція розподілу дефектів, величина якої пропорційна концентрації дефектів у плівці.

У явному вигляді $F_0(E)$ записується так:

$$F_0(E) = -\frac{1}{kU} \frac{\partial \rho_i}{\partial T},$$

де $U = \frac{u(u+2)}{u+1}$ (u знаходиться із рівняння $u + \lg u = \lg \frac{4n t \omega_{\max}}{2\pi}$);

$\frac{\partial \rho_i}{\partial T} = \frac{\partial \rho}{\partial T} - \frac{\partial \rho_1}{\partial T}$ (ρ і ρ_1 – питомий опір при першому нагріванні та охолодженні);

$$E = u k T .$$

Оскільки $\omega_{\max} = \frac{k\Theta_D}{\hbar}$ (Θ_D – температура Дебая), то для розрахунків u , U , E і $F_0(E)$ необхідно знати величину Θ_D , яка дещо відрізняється від температури Θ_{0D} для масивних зразків. У нашій ситуації ми змогли скористатися лише розрахунковою величиною Θ_D як середньовиваженою між Θ_{0D}^{Ni} і Θ_{0D}^{Cu} , тобто

$$\Theta_D = C_{Ni} \cdot \Theta_{0D}^{Ni} + (1 - C_{Ni}) \cdot \Theta_{0D}^{Cu} .$$

Хоча така методика розрахунків ці сплавів загальноприйнята (див., наприклад, [7]), але точність їх визначається близькістю величини Θ_{0D} для окремих компонент. У таблиці 1 як приклад розрахунку наведена залежність Θ_D від концентрації для плівок сплаву для постійної товщини $d \approx 70-77$ нм. Одержані таким чином величини Θ_D були нанесені на графіки термостабілізаційного відпалювання (на рис.3 наведено три таких графіки), із яких випливає, що початок відпалювання дефектів приходиться на температуру $T \approx \Theta_D$.

Таблиця 1 - Залежність Θ_D від концентрації

d , нм	C , ат.% Cu	ψ_D , К
Масивний	100	465
71 15 (Cu) 56 (Ni)	21	439
77 30 (Cu) 47 (Ni)	39	417
76 35 (Cu) 41 (Ni)	47	408
74 40 (Cu) 34 (Ni)	54	399
70 43 (Cu) 27 (Ni)	62	389
70 57 (Cu) 18 (Ni)	81,5	365
75 65 (Cu) 10 (Ni)	87	359
Масивний	0	343

Результати розрахунків спектрів дефектів для пілікових сплавів наведені на рис.4. Характерними їх особливостями є такі. При малих концентраціях атомів Ni спостерігається два максимуми при енергіях «заліковування»: $E_1 = 0,46$ і $E_2 = 0,58$ еВ, які відрізняються від відповідних величин для піліковок Cu ($E \approx 0,67$; 0,77 та 0,90 еВ). При зростанні концентрації атомів Ni з'являється додатковий максимум при $E_3 = 0,70-0,75$ еВ, висота якого збільшується при подальшому збільшенні концентрації Ni. Відносно мала величина енергії «заліковування» говорить про те, що «заліковуються» не дефекти пакування, а відбувається рекомбінація пар вакансія . міжузловий атом.

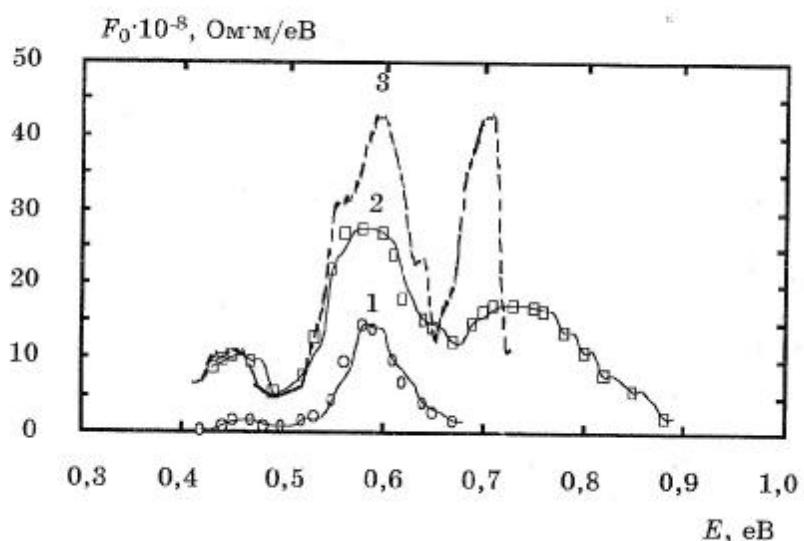


Рисунок 4 - Спектр дефектів для пілікових сплавів.
Концентрація, ат%Ni: 27(1), 33(2), 74(3).
Товщина $d \approx 60$ нм; швидкість конденсації $\omega \approx 0,5-1$ нм/с

2.2 Кристалічна структура

Піліки сплаву (Ni-Cu) у всіх досліджених нами інтервалах товщин концентрацій і температур мають ГЦК-решітку із параметром, який залежить від концентрації і змінюється в межах від $a = 0,350$ до $a = 0,364$ нм, що добре узгоджується із даними для масивних сплавів.

($a_0 = 0,3524\text{--}0,3615$ нм). На рис.5 наведена концентраційна залежність параметра решітки сплаву, яка отримана при $T = 300\text{K}$.

Привертає увагу той факт, що в плівках сплаву параметр решітки значно більший у порівнянні із масивними зразками. Це збільшення частково можна пояснити проникненням атомів із залишкової атмосфери в решітку сплаву, а частково тим, що атоми однієї з компонент у процесі конденсації займають позиції, які не відповідають впорядкованому сплаву. Не до кінця нам зрозуміла роль оксиду Cu_2O , який утворюється при відпалюванні зразків плівкового сплаву до 700K і може спричинити макронапруження розтягувального характеру. В невідпалених зразках кристалічна структура виключно дисперсна (середній розмір кристалітів $L \approx 5$ нм), що обумовлює кутове розширення ліній на електронограмах. При цьому хоча перша лінія (111) дуже широка і складається враження, що вона подвійна (це буде мати місце тоді, коли плівковий сплав має евтектичну будову ГЦК Ni + ГЦК Cu), різниця $d_{111}(\text{Cu}) - d_{111}(\text{Ni}) = 0,004$ нм достатньо велика, що дозволило б спостерігати окрім лінії (111) Ni та Cu (зауважимо, що у випадку сплаву (Ni-Co) [5] нами спостерігалися окрім лінії (111) ГЦК Ni та ГЦК Co при $\Delta d_{111} < 0,002$ нм). Таким чином, ГЦК-сплав (Ni-Cu) утворюється вже на стадії конденсації. На електронограмах від відпалених зразків фіксуються додаткові лінії Cu_2O (від 2 до 5 ліній), які дуже тонкі, що говорить про відносно великий середній розмір кристалітів цього оксиду. Він має ГЦК-решітку із параметром $a = 0,424\text{--}0,450$ нм. Відмітимо, що дві найбільш інтенсивні лінії Cu_2O ((111) та (220)) спостерігаються на електронограмах і від свіжосконденсованих плівок при швидкості їх одержання $\omega \leq 0,2$ нм/с. Крім того, зауважимо, що в наших експериментальних умовах не спостерігалися лінії нестабільного оксиду NiO або стабільного нітриду Ni_3N , хоча в окремих випадках зазначене фазоутворення має місце.

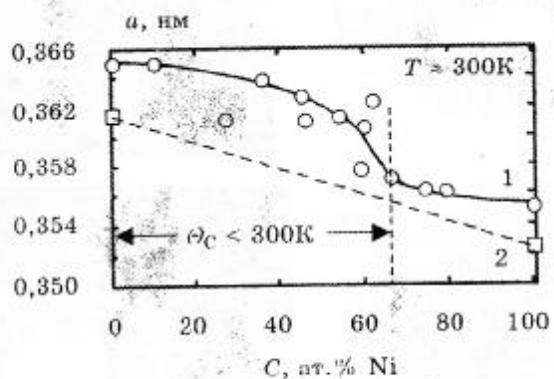


Рисунок 5. Концентраційна залежність параметра ГЦК-решітки в плівках сплаву (1) та масивних зразках (2).

При концентрації (60-65) від. % Ni відбувається концентраційний фазовий перехід парамагнетик-феромагнетик

На електронно-мікроскопічних знімках кристаліти Cu_2O на перших стадіях відпалювання фіксуються у вигляді напівпрозорих темних областей на поверхні зразка, але при збільшенні температури вони проростають в об'єм плівки. На рис.6. подана серія мікрознімків та електронограм, які ілюструють процеси утворення Cu_2O та рекристалізації плівкового сплаву із паралельною полігонізацією (роздавлення зерен на окремі субзерна двійниками термічного походження). Зауважимо, що у відпалених зразках середні розміри

кристалітів до полігонізації мають величину 100-300 нм, що значно більше у порівнянні із вихідними зразками. Важливо зауважити, що процеси полігонізації не впливають помітно на електрофізичні властивості (див., наприклад, рис.3), оскільки рекристалізаційні процеси їх перекривають.

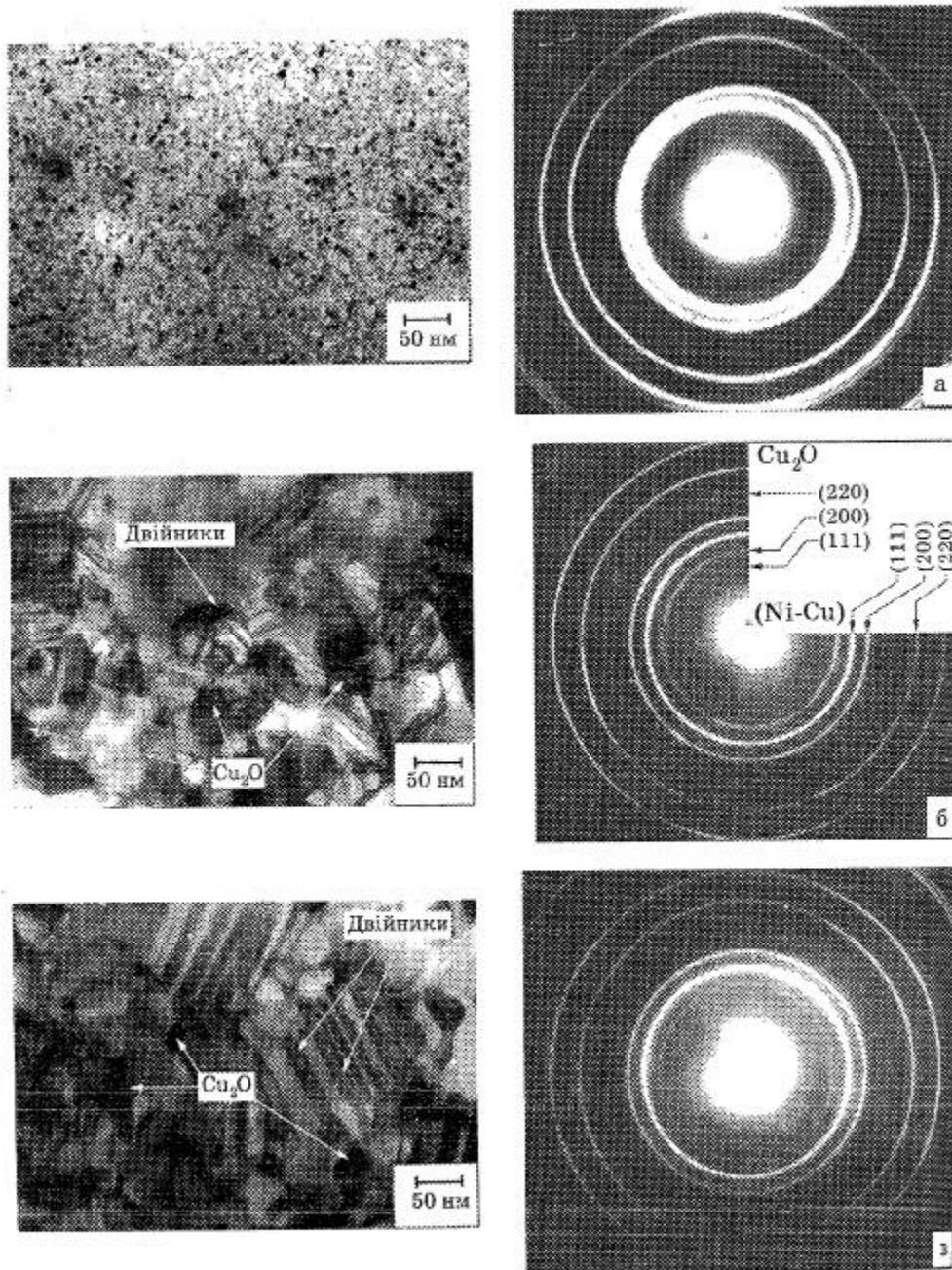


Рисунок 6 - Мікроструктура і відповідні електронограми для пленкового сплаву (Ni-Cu):

- а - невідроджений зразок ($C = 60$ ат% Ni, $d = 40$ нм);
- б - відроджений зразок ($C = 60$ ат% Ni, $d = 80$ нм);
- в - відроджений зразок ($C = 38$ ат% Ni, $d = 80$ нм)

2.3 Електрофізичні властивості

Дослідження електрофізичних властивостей (пітому опір або ТКО) плівкових сплавів свідчать про те, що тут мають місце ті самі розмірні ефекти, як і у випадку однокомпонентних зразків, тобто зовнішній і внутрішній розмірні ефекти.

Зовнішній розмірний ефект обумовлює залежність ρ і β від товщини, а внутрішній – їх абсолютну величину. На рис.7 показаний приклад зовнішнього розмірного ефекту в ТКО для однокомпонентних плівок Ni та Cu і сплаву із постійною концентрацією $C \approx 40$ at% Ni.

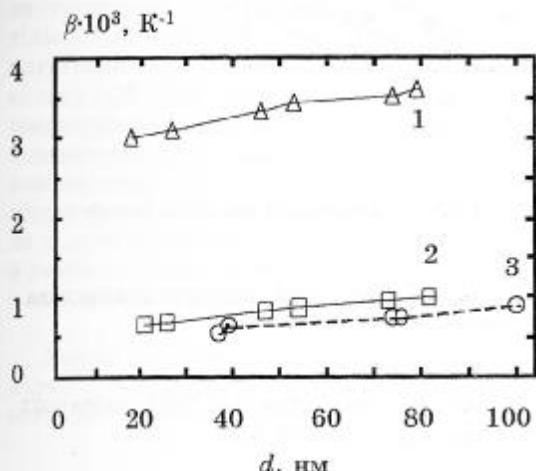


Рисунок 7 - Розмірна залежність ТКО для плівок Ni (1), Cu (2) та сплаву (Ni-60 at.%Cu) (3)

Збільшення ТКО із товщиною пояснюється все меншим і меншим внеском поверхневого розсіювання електронів у загальний опір плівки. В той самий час залишається незрозумілою для нас причина більших значень ТКО плівок у порівнянні із масивними зразками (в однокомпонентних плівках завжди навпаки), як це випливає із концентраційної залежності, наведеної на рис.8. Однією із можливих причин цього може бути та обставина, що дані [2] для масивних сплавів отримані на більш дисперсних зразках.

Великий інтерес становить порівняння експериментальних і теоретичних величин для ТКО. Оскільки теорія електропровідності сплавів розробляється давно, то в літературі відомий ряд співвідношень на основі моделі Мотта (див., наприклад, [7,8]), але їх, на жаль, застосувати до експериментальних результатів для плівкових сплавів не завжди можливо. Однак у випадку ізоелектронних переходних металів можна скористатися простим співвідношенням [7] для питомого опору сплаву

$$\rho(T) = \rho_{\text{зас}} + C_1 \cdot \rho_1(T) + C_2 \cdot \rho_2(T), \quad (4)$$

де 1 і 2 – номери окремих компонент сплаву;

$\rho_{\text{зас}}$ – залишковий опір, який не залежить від температури.

Оскільки Ni та Cu лише в окремих випадках можуть поводити себе як квазіізоелектронні метали, то невідомо, наскільки правомірно застосовувати наведене співвідношення (4) до сплаву (Ni-Cu).

Від співвідношення для $\rho(T)$ легко перейти до $\beta(T)$:

$$\beta(T) = \frac{1}{\rho(T)} \cdot \frac{\partial \rho(T)}{\partial T},$$

або

$$\beta(T) = \frac{1}{\rho(T)} \cdot \frac{\partial}{\partial T} (C_1 \cdot \rho_1(T) + C_2 \cdot \rho_2(T)) = \frac{\beta_1(T)}{1 + \frac{C_2 \cdot \rho_2(T)}{C_1 \cdot \rho_1(T)}} + \frac{\beta_2(T)}{1 + \left(\frac{C_2 \cdot \rho_2(T)}{C_1 \cdot \rho_1(T)} \right)^{-1}}, \quad (5)$$

де індекс “1” належить до Ni, а “2” – до Cu.



Рисунок 8 · Концентраційна залежність ТКО для плівкових і масивних сплавів

У таблиці 2 наведені експериментальні дані, які використовувалися для розрахунків ТКО плівкових сплавів.

Таблиця 2 · Експериментальні дані для розрахунків ТКО плівкових сплавів (інтервал товщин $d_1 = 10\text{-}60 \text{ нм}$, $d_2 = 15\text{-}155 \text{ нм}$)

$\#$	C_1 , ат % Ni	$d=d_1+d_2$, нм	$\frac{\rho_2}{\rho_1}$	$\frac{C_2}{C_1}$	$\beta_1 \cdot 10^3$, K^{-1}	$\beta_2 \cdot 10^3$, K^{-1}	$\bar{\beta} \cdot 10^3$, K^{-1}	$\beta_{\text{пос}} \cdot 10^3$, K^{-1} за спв.(2)
1	10	97	2,17	9,0	2,0	1,2	1,8	1,24
2	13	162	1,83	7,0	2,8	1,4	1,4	1,54
3	14,5	89	4,07	5,9	2,2	1,1	1,3-1,4	1,17
4	20	80	5,00	4,0	2,4	1,0	0,6	1,06
5	22	188	1,74	3,5	3,4	1,4	0,5-0,6	1,73
6	25	63	6,50	3,0	2,4	0,95	0,7	1,02
7	32	103	5,21	2,1	3,4	1,1	0,6	1,29
8	38	37	8,46	1,6	2,2	0,82	0,6-0,9	0,94
9	46	40	8,91	1,2	3,6	0,76	0,2-0,8	0,90
10	54	40	9,84	0,85	2,8	0,65	0,8	0,92
11	79	71	12,9	0,26	2,8	0,61	0,9	1,35

Як видно із рис.8, розрахункові дані в цілому розміщуються вище експериментальних, хоча тенденція проходження концентраційної залежності через мінімум зберігається. Для прогнозу більш точних величин ТКО плівкових зразків необхідно користуватися двозонною моделлю Мотта (наприклад, у варіанті, наведеному в [8]), оскільки

густота енергетичних станів для Ni і Cu в околі енергії Фермі значно відрізняються. Поряд з цим співвідношення (5) дуже зручне своюю простотою для оцінки порядку величини ТКО не тільки для сплаву (Ni-Cu), а й інших пілікових сплавів.

ВИСНОВОК

Проведені вперше нами комплексні дослідження фазового складу, кристалічної будови, спектру дефектів та електрофізичних властивостей пілікових сплавів дозволяє стверджувати, що основні риси зовнішнього і внутрішнього розмірних ефектів мають місце у пілікових сплавах не тільки (Ni-Co) [5], але і в (Ni-Cu). Зафіксовано концентраційний магнітний перехід при $T = 300\text{K}$ на залежності параметра ГЦК-решітки сплаву (Ni-Cu) від концентрації. Порівнюючи експериментальні та розрахункові на основі (4) та (5) дані, встановлено, що загальні риси концентраційної залежності збігаються між собою і з аналогічною залежністю для масивних сплавів. У той самий час відмінність в абсолютних величинах говорить про те, що експериментальні результати не відповідають правилу Маттіссена, і тому прогноз ТКО необхідно вести в рамках двозонної моделі Мотта із урахуванням можливості розсіювання з-електронів у s - і d -зону.

Автори висловлюють щиру подяку доктору фізико-математичних наук, професору Проценку І.Ю. за участь в обговоренні експериментальних результатів.

SUMMARY

The complex researches of phase composition, crystalline structure, imperfections and electrophysical properties of thin films of an alloy (Ni-Cu) in a wide interval of thickness, concentration and temperatures are spending.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Диаграммы состояния металлических систем. Вып. XXXII /Н.И.Ганина, А.М.Захаров, В.Г.Оленичева и др./ - М.: ВИНИТИ. - 1988. - 626 с.
2. Таблицы физических величин//Под ред. И.К. Киксона. - М.: Атомиздат, 1976. - 1006 с.
3. Липецкий Я.Л., Столяров В.Л. Физические свойства напыленных металлических пленок//Итоги науки и техники. Металловедение и термическая обработка. - М.: ВИНИТИ, 1986. - Т.20 - С. 98-150.
4. Смещение границ растворимости в высокодисперсных системах/ Чижик С.П., Гладких Н.Т., Григорьева Л.К. и др.///Металлы. - 1985. - Т.2. - С.175-177.
5. Structure and electrophysical properties of Ni-Co alloy films within 300-1300 K temperature range/Kravchenko V.A., Loboda V.B., Protsenko I.Yu. et all. // Functional materials. - 1999. - V.6. - №5. - P. 892-895.
6. Vand V. Theory of the irreversible electrical changes of metallic films evaporated in vacuum//Pros. Phys. Soc. - 1943. - №55. - P.222-246.
7. Цювкин Ю.Ю., Волошинский А.Н. Расчет температурных и концентрационных зависимостей электросопротивления сплавов в двухполосном приближении когерентного потенциала//ФММ. - 1993. - Т.75. - Вып.3. - С.29-37.
8. Коуров Н.И., Тюленев Л.Н., Верещагин Ю.А. Электросопротивление и термозаде упрацюючих сплавов Fe₂₅Pd_{75-x}Au_x//ФММ. - 1993. - Т.75. - Вып.5. - С.75-79.

Надійшла до редколегії 24 липопада 2000 р.